

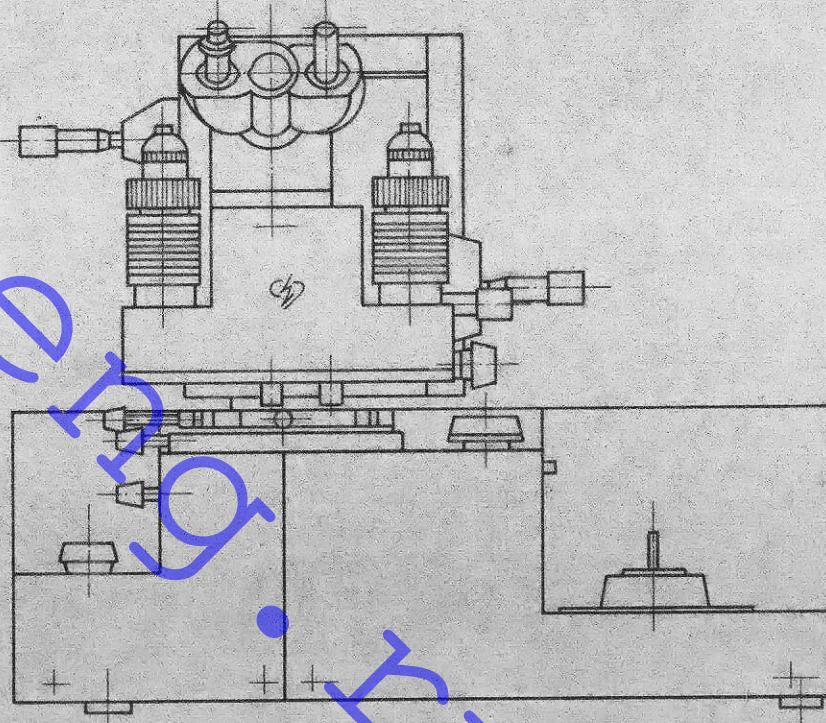
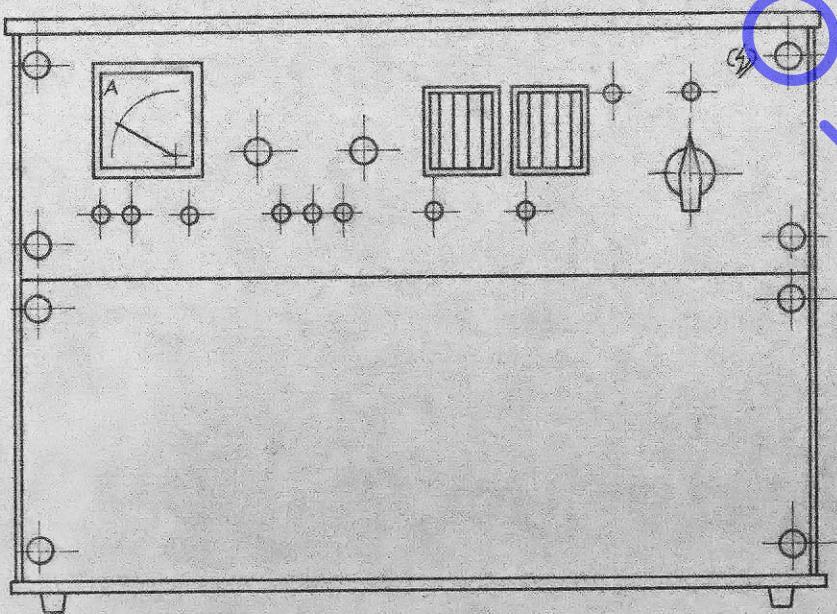
I	II	III	IV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Disposition																												Disposition-Nr.	Inventar-Nr.																	
Прочие стаки и оборудование для электропромышленности																												I32 51 100																		
Art																												Waren-Nr.	Betriebs-Nr.																	
Spezialbezeichnung																												Kurzzeichen																		
Установка для совмещения и экспонирования																												ЭУВ 76/6																		
Hersteller														Bauart	2104.16	Erzeugnis-Nr.	2104.16																													
Lieferer														Baujahr	1980	Garantiezeit	по контракту																													
Завод-изготовитель: Народное предприятие Электромат предприятие комбината по микроэлектронике														Standort		Anschaffungswert																														
Rechsträger														Inbetriebnahme																																
1.														ab Datum	Standort																															
2.															Abt./Abschn./Brig.																															
3.															Standort																															
4.															Abt./Abschn./Brig.																															
Name des Prüfers														Standort																																
Zeitwert														Abt./Abschn./Brig.																																
Gütegrad														Standort																																
Datum der Überprüfung														Abt./Abschn./Brig.																																
Hauptabmessungen Габариты / шир. х гл. / основной прибор: 680x620x500 коммутац. устройство: 545x365x400 общий вес: ок. 170 кг														Standort																																
Massen														Abt./Abschn./Brig.																																

~~Иллюстрации см. на 2-ом листе~~

JUB 76 G

2104.16/11

Bl-Nr. 2



www.sorengi.eu

1. Техническая характеристика

1.1. Обрабатываемые материалы

1.1.1. Полупроводниковая пластина

диаметр d /мм/

76^+1

61^+1

51^+1

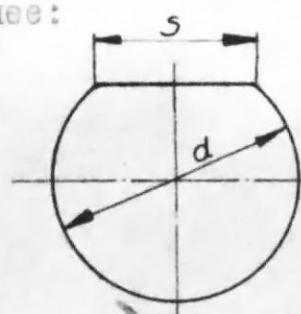
36^{+2}

толщина s /мм/:

$0,2 \dots 0,4$

альтернативно с фаской или без нее:

соотношение $\frac{d}{s} \geq 2$



Качество полупроводниковой пластины соответствует стандарту ТГЛ 32974/01 проект 5/77/, задняя сторона или притирается или протравливается.

5

1.1.2. Шаблоны

Размеры:

ном. размер	размер для разрезки /мм/	фаска /мм/
100 мм	/100 x 100/ $\pm 0,5$	$0,1 \dots 0,8$
4 дюйма	/101 x 101/ $+0,6$ $-0,5$	-
70 мм	/70 x 70/ -1	$0,1 \dots 0,6$
63,5 мм	/63 x 63/ $+0,5$	$0,1 \dots 0,5$
50 мм	/49 x 49/ $+0,6$ $-0,5$	$0,1 \dots 0,2$

Угол подрезки: $90^\circ \pm 1^\circ$

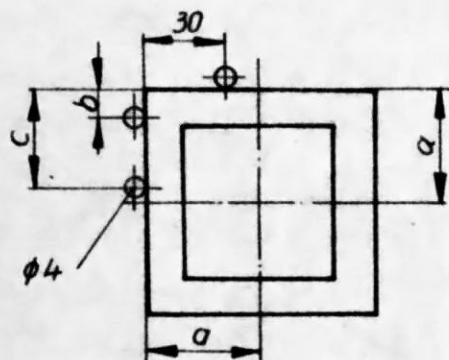
Опорные поверхности шаблона должны быть плоскими без нанесенных слоев лака или хрома или должны иметь непрерывные покрытия лака или хрома.

Допуски размеров допускается одновременно исчерпывать только до такой степени, чтобы полностью перекрывался квадрат с длиной кромок соответствующего размера подрезки за вычетом минусового допуска. Выполнение этого условия обязательно также и тогда, если предполагается полностью использовать или допуск углов или допуск размеров подрезки или полной ширины фаски.

Толщина шаблона: ≤ 3 мм

Расположение участка для наложения шаблонов

Рекомендуется использование шаблонов, поле которых по отношению к упорам шаблонодержателя занимает вышеписанное расположение:



ном. размер шаблона	расстояние а	/кромка упора шаблона по отношению к центру поля/
100 мм	$/50 \pm 0,25/$ мм	$c = 3$ мм
4 дюйма	$/50 \pm 0,25/$ мм	$a = 43$ мм
70 мм	$/35 \pm 0,25/$ мм	
63,5 мм	$/31,5 \pm 0,25/$ мм	$b = 5$ мм
50 мм	$/24,5 \pm 0,25/$ мм	$c = 45$ мм

6

I.2. Системы для позиционирования

I.2.1. Пределы перемещения подложки для пластин

координата X-Y: в пределах круга диам. 3 мм I/
координата Z: грубое перемещение: 1,5 мм
тонкое перемещение: /0 ... 50/ мк
с непрерывным подбором: с автоматической регулировкой

координата Y: 5°

I/ С учетом привязки диаметров подложек к размерам шаблонов с учетом соответствующих допусков подсчитываются нижеприведенные ходы перемещения подложек в направлениях осей X и Y:

номинальный размер /мм/	размеры шаблонов/мм/	пределы перемещения хода в направлениях осей Х и У /мм/
----------------------------	----------------------	---

76	100 x 100 101 x 101 /4" x 4"/	диаметр 3
----	----------------------------------	-----------

	70 x 70 72 x 72	диаметр 2
--	--------------------	-----------

61	до 90 x 90	диаметр 3
----	---------------	-----------

51	63,5 x 63,5 66 x 66	диаметр 2
----	------------------------	-----------

	до 90 x 90	диаметр 3
--	---------------	-----------

36	50 x 50 52 x 52	диаметр 2
----	--------------------	-----------

	до 90 x 90	диаметр 3
--	---------------	-----------

1.2.2. Путь перемещения шаблона

Координата Х-У:

координата Σ :

5 мм
10°

I.3. Точность совмещения /перекрытия/

В каждой измерительной точке в готовом для экспонирования состоянии на любой координате $\leq 0,3 \text{ мк}$

I.4. Предварительное позиционирование

Загрузка полупроводниковой пластины производится по выбору с предварительным позиционированием или без него.

Повторимость результатов
исследования: $\leq 0,1 \text{ мм}$

I.5. Создание контакта между полупроводниковой пластиной и шаблоном

Зажим пластины : разрежением по направлению к подкладке пластины

зажим шаблона : разрежением по отношению к подкладке шаблона

контактное усилие прижима: разрежением, создаваемым между п/п пластиной и шаблоном

I.6. Пригодные для нанесения структуры:

Контактное экспонирование: 1 мк

экспонирование на расстоянии /расстояние 20 мк/ 5 мк

I.7. Микроскоп

Объективы: 10x/0,2 00/-

окуляры: РК 6,3 x

РК 12,5 x

РК 20 x

соответствующее увеличение: 63-кратное
125-кратное
200-кратное

соответствующий диаметр поля кадра 1,9 мм

1,6 мм

0,8 мм

точность оптического совмещения:

I/ 0,25 мк

I/ расчетная величина

1.7.1. Пределы перемещения микроскопа в направлении координат X и Y
Это перемещение предназначено для позиционирования объективов на соответствующие метки сопряжения на шаблоне.

координата X	± 8 мм
координата Y	± 8 мм

1.7.2. Пределы перемещения объективов в направлении координат X
левый объектив: неподвижный; 8 мм слева от центра подставки для пластины при установке узла точного регулирования X и Y микроскопа на величину 8,0
правый объектив: перемещающийся на /22 ... 40/ по отношению к неподвижному объективу

1.7.3. Пределы перемещения объективов в направлении оси координат Z
/режим фокусировки/
пределы фокусировки обоих объективов + 3 мм
/параллельная работа/ - 0,8 мм
пределы фокусировки правого объектива : $\pm 0,1$ мм

1.7.4. Установка для освещения
Надирекционный свет, отдельно выключаемый педальным выключателем для левого и правого объективов.
Регулировка яркости освещения: электрическое, регулируемое ступенями путем изменения напряжения

Источник освещения: 2 штуки кинопроекционных лампы РЛ-6т-15 вт по ТГЛ 10619

фильтрация света: встроенным узлом для фильтрации света КП14 для каждого хода трактории прохождения света для изображения

1.8. Система экспонирования

Источник света: НВО 201
или НВО 200 и ДРЩ 250

держатель /патрон/ лампы: перемещаемый в направлении осей координат x, y и z

Оптика для экспонирования: трехлинзовый сферический конденсор из стекла БК 7

Неравномерность освещения в случае применения лампы НВО 201 при длине волн $\lambda = 350 \dots 450$ нм при диаметре 80 мм:
продолжительность горения ≤ 200 ч, макс. 10%

Ламповый ток: постоянный ток

уставка заданных значений в соответствии с картой с информационными данными для кинопроекционной лампы/ ступенчатое регулирование, контроль индикаторным инструментом/

Охлаждение лампового фонаря: водяное охлаждение

Защита от превышения температуры при прекращении подачи охлаждающей воды: электрическое температурное реле для отключения лампового тока

Экспонирования:

управление временем выдержки экспонирования или регулировка выдержки экспонирования

В коммутационное устройство установлен управляемый электронный счетчик с возвратом в исходное положение, с индикацией количества произведенных циклов экспонирования.

1.9. Управление выдержкой времени экспонирования

Электронное регулирование времени экспонирования светового затвора в траектории прохождения световых лучей:

выдержка времени экспонирования на счетчике с предварительной уставкой:

$$tn = n \cdot \Delta t \pm 2\% \quad 1/$$

интервал времени:

$$\Delta t = 0,1 \text{ сек.}$$

декадная /десятичная/ уставка: $n = 10 \dots 999$

точность уставки: 1 %

1/ При времени экспонирования в пределах от 1 .. 9 сек время выдержки экспонирования уменьшается на < 0.05 сек.

Выдержка времени:

автоматическое регулирование путем поворота поворотного плача в позицию экспонирования или брученую нажатием на кнопку "старт"

Прекращение выдержки
/интервала выдержки/:

автоматическое в соответствии с уставкой счетчика

или при положении уставки "ручной режим" нажатием на кнопку "стоп"

1.12. Регулировка для выдержки времени экспонирования

Электронное регулирование экспонирования $H_t =$ непрерывное изменением времени выдержки.

Засыпывание:

$$H_t = n \cdot \Delta H$$

$$\Delta H = \int_0^X E dt \pm 2\% \quad I/$$

Декадная уставка: $n = 10 \dots 999$

Эталонная температура: $T = 23^{\circ}\text{C} \pm 1 \text{ К/град}$

температурная погрешность: $E_T = 0,35\%/\text{К}/\text{град}$

допуск согласования калибровочной характеристики: $\pm 2\%$

11

I/ Эта точность относится к 1000-м часам экспозиции

Прекращение времени экспонирования: автоматическое в зависимости от уставки на счетчике

или в условиях уставки на "ручной режим" нажатием на кнопку "стоп"

1.13. Технология экспонирования

Контактное экспонирование

/ переключается по выбору

дистанционное экспонирование

/ нажатием на кнопку "нажатия"

1.14. Управление программным циклом

автоматическое протекание отдельных операций в соответствии с выбором программы на выключателе I/ или выключателе II/ применением pneumaticским блоком для логического управления /системы "Дрелса"/

на выключателе III альтернативно могут использоваться два процесса дистанционного экспонирования в режиме состояний их уставки.

1.15. Азотная промывка

Экспонирование полупроводниковых пластинок может при необходимости проводиться в среде остаточного содержания азота или состоять из азота.

1.16. Производительность установки /без смены шаблона/

Выдержка времени экспонирования повышается примерно на 33 % по сравнению к типу аппаратуры 2104.11/12. В предположении переноски аналогичных структур предполагается время выдержки экспонирования порядка 6,7 сек.

1.16.1. Частичное экспонирование

Загрузка или разгрузка полупроводниковой пластины и установка времени выдержки: ≤ 28 сек.

предполагаемая выдержка времени экспонирования: 6,7 сек.

время цикла: $\leq 34,7$ сек.

производительность: ≥ 104 пластинок/час

1.16.2. Последовательные экспонирования

Загрузка и разгрузка полупроводниковой пластины и установка времени экспонирования: ≤ 28 сек.

точное совмещение: ≤ 35 сек.

предполагаемая выдержка времени экспонирования: 6,7 сек.

время цикла: 64,7 сек.

производительность: ≥ 52 пластинок/час

1.17. Расход /потребление/ электроэнергии:**1.17.1. Подключение электропитания**

Напряжение питания: $220 \text{ В} \pm 5\%$; 50 Гц однофазного переменного напряжения

потребляемая электроэнергия: ок. 1 кВт

аппаратная розетка: И 93 Э по ТГЛ 19486
/для подключения сети/